科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 2 9 年 5 月 2 3 日現在

機関番号: 17102
研究種目: 基盤研究(B)(一般)
研究期間: 2014 ~ 2016
課題番号: 26289274
研究課題名(和文)分散粒子を含まない溶液から活性金属微粒子を共析させた高耐食性複合電析膜の開発
研究課題名(英文)Development of High corrosion-resistant electrodeposited composite films with fine active metals from Dispersed-Particle-Free Solution
研究代表者
中野 博昭(NAKANO, Hiroaki)
九州大学・工学(系)研究科(研究院)・教授
研究者番号:7 0 3 2 5 5 0 4
_ 交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 10,100,000円

研究成果の概要(和文):Zn2+,Zrイオンを含む硫酸塩水溶液からZn-Zr酸化物の複合電析を行い,電析挙動と 得られた電析膜の構造を調査した。電析膜のZr含有率は、pH2の溶液からの方がpH1からより高く、電流密度が高 くなると増加した。微小Sb電極法によ測定した陰極界面のpHはZr02生成の臨界pHに近い 2.2前後となっているこ とが分かった。SEM,EDXよりZrはZn板状結晶の板面上および板状結晶と板状結晶の隙間部に粒状の酸化物として 共析することが分かった。3%NaCI水溶液中では、Zn-1.1mass%Zr酸化物の腐食電位は純Znより貴となり、腐食電 流密度は純Znより低下した。

研究成果の概要(英文): Electrodeposition of Zn-Zr oxide composite from an unagitated sulfate solution containing Zn2+ and Zr ions was investigated. The Zr content was higher in deposits formed from the solution at pH 2 than in those formed from the solution at pH 1 and, when the current density was increased, the Zr content in the deposits increased. The pH in the vicinity of the cathode, as measured using an Sb microelectrode, was approximately 2.2, which is similar to the critical pH for the formation of ZrO2. Scanning electron microscopy and energy-dispersive X-ray spectroscopy point analysis of the deposits revealed that granular Zr oxide was deposited at the surfaces of the Zn platelet crystals and in the voids between the crystals. Polarization curves in 3 mass% NaCl solution revealed that the corrosion potential of the deposited Zn - 1.1 mass% Zr oxide films was more noble than that of Zn films and that the corrosion current density of the Zn - 1.1 mass% Zr oxide films was lower than that of Zn films.

研究分野: 材料電気化学

キーワード: 電析 亜鉛 ジルコニウム酸化物 分極曲線 複合酸化物 耐食性 腐食電流 微小アンチモン電極

1. 研究開始当初の背景

(1) 複合電析は,素材に耐摩耗性,潤滑性, 耐食性などの機能を付与することができる。 複合電析では,通常,分散材として微粒子を 電解液中に懸濁させ,電析の際にその微粒子 を皮膜中に取り込む。微粒子は,電解液中お よび陰極界面で凝集し易いため,電析膜に微 細な状態では共析し難い。また,電解液中で 凝集した微粒子が沈降するため製造プロセ ス上の問題点も多い。

(2) 水溶液からの Zn など卑な金属の電析で は、陰極反応で水素が発生するため、陰極界 面のpHが上昇する。そこで、低pH で加水分 解する金属イオンを液中に添加すると、その 金属イオンが水酸化物あるいは酸化物とな り電析膜中に共析する可能性がある。この加 水分解反応を利用した電析は、電解液に分散 粒子を添加することなく金属イオンの状態 からスタートできるため、nm レベルの超微 細粒子を共析させる可能性があり新たな電 析膜の特性が期待できると共に、従来の複合 電析の製造上の問題点も解決出来る。

2. 研究の目的

鉄鋼の Zn 系表面処理膜は、溶融めっき法 および電気めっき法により製造されている。 これまでに溶融めっき、ドライプロセスで作 製された Zn 系合金膜の評価結果から, Mg, Al, Ti などの標準単極電位が Zn より卑な活 性金属が Zn 膜に含有されると耐食性が向上 することが分かっている。Zr もその標準単極 電位が-1.53 V(vs. NHE)と Zn(-0.76 V)より卑 な活性金属であり、Zn 膜中に Zr 酸化物を含 有させれば耐食性の改善が期待されるが, Zr 酸化物の共析についてはこれまでにほとん ど報告されていない。そこで、本研究では、 Zn²⁺より低い pH で加水分解する Zr⁴⁺を電解 液に添加し、Zn-Zr 酸化物複合電析の検討を 行なった。Zr 酸化物の共析量に及ぼす電析条 件の影響, 電解液の pH 滴定曲線および電析 時の陰極界面の pH を調べ, Zr 酸化物の共析 挙動を検討した。また,Zr 酸化物を含有した 電析 Zn 膜中の Zr の分布状態および分極特性 を調べた。

3. 研究の方法

(1) 電解液は市販の特級試薬を用い, ZnSO₄・7H₂O 0.52 mol・dm⁻³, Zr(SO₄)₂・4H₂O 0.1 mol・dm⁻³を純水に溶解させて作製した。 pH は硫酸により1,2 に調整した。電析は, 定電流電解法により電流密度10から5000 A・m⁻²,通電量10⁵ C・m⁻²,浴温313 K において無撹拌で行なった。陰極にはCu板(2 cm×1 cm),陽極にはPt板(2 cm×1 cm)を用い た。得られた電析膜は硝酸で溶解し,ICP 発 光分光分析法によりZn,Zrを定量し、電析合 金組成,Zn電析の電流効率およびZn 析出の 部分電流密度を求めた。

(2) 電析膜の表面および断面を低加速電圧 SEM の二次電子像および反射電子像により 解析した。電析膜の Zn の結晶配向性を X 線 回折装置(Cu-Kα, 管電圧 40 kV, 管電流 20 mA)により測定した。電解液の加水分解挙動 を調べるため, NaOH を用いて pH 滴定曲線 を測定した。各々0.05 mol・dm⁻³の ZnSO₄と Zr(SO₄)2の混合液およびそれぞれの単独液に ビュレットを用いて 5.0 mol・ dm^{-3} の NaOH を 滴定した。また、電析時の水素発生による陰 極近傍の pH 変化を調べるために, 微小 Sb 電 極を作製した。実験は、静止液において 300 $A \cdot m^{-2}$ で電解する際、マイクロメータに取り 付けた微小 Sb 電極を陰極面に接触するまで 近づけ, 陰極から所定の距離における Sb 電 極の電位を測定した。測定前にあらかじめ求 めた電解液の pH と Sb 電極の電位との関係 (pH-電位校正曲線)を利用して,電解時におけ る陰極層の pH を求めた。分極曲線は,酸素 を飽和させた 313 K, 3 mass% NaCl 水溶液中 において、電位掃引法により 1.0 mV・s⁻¹ の 速度で卑な電位から貴な電位に移行させ測 定した。

4. 研究成果

(1) 電析膜の Zr 含有率に及ぼす電流密度, 電解液 pH の影響を調べた。なお、本報告 における電析膜の Zr 含有率(mass%)は、電 析膜の Zr, Zn 濃度より[Zr/(Zn+Zr)]×100 により算出したものである。図1に示すよ うに電析膜の Zr 含有率は,何れの pH にお いても電流密度が10A·m⁻²から高くなるほ ど一旦減少し, 100 A·m⁻²以上になると電 流密度の増加に伴い徐々に増加した。また, 何れの電流密度においても, pH2の方が pH 1の場合より Zr 含有率は高くなった。高電 流密度の領域において, 電流密度が高くな るほど電析膜の Zr 含有率が増加したのは, 電流密度の増加に伴い水素発生速度が速く なり陰極界面で pH が上昇し Zr イオンが加 水分解し易くなるためと考えられる。同様 に、電解液のpH が高い方がZr イオンが加 水分解し易く Zr 含有率が増加したと考え られる。





(2) Zn-Zr 酸化物複合電析における Zn の電 流効率に及ぼす電流密度と pH の影響を調査 した。図2に示すように、Zn 析出の電流効率 は,何れの pH においても,電流密度が 10 A・ m⁻²から高くなるほど増加し,最大値を示し た後、更に電流密度が高くなると低下した。 低電流密度の領域で、電流密度が高くなるほ ど Zn 析出の電流効率が増加したのは、Zn 電 析の過電圧が増加するためであり、高電流密 度域で、電流密度が高くなるほど Zn の電流 効率が低下したのはZn²⁺イオンの拡散限界に 到達したためと考えられる。一方, Zr イオン の影響を見ると、50 A・m⁻²以下の低電流密度 および pH2 の 1000 A・m⁻²以上の高電流密度 密度の領域において, Zr イオンが共存すると Zn の電流効率は若干,低くなった。同様に pH が低くなると、1000 A・m⁻²以下で Zn の 電流効率は少し低くなった。ところで、図 1 に示すように低電流密度域では、何れの pH においても電流密度が低下するほど Zr 含有 率が増加したが、この一因として、図2に示 すように電流密度が低下するほど Zn の電流 効率が低下することが考えられる。





(3) Zn²⁺, Zr イオンを含む電解液からの Zn 析 出の部分分極曲線を調べた。Zr イオンの影響 を明らかにするためZn²⁺のみを含む電解液に おける部分分極曲線も調査した。 電解液に Zr イオンを含む場合と含まない場合を比較す ると, Zr イオンを含む方が 200 A・m⁻²以上の 電流密度域において分極することが分かっ た。(図 3)この傾向は、pH 2 の電解液で特に 顕著であった。200 A・m⁻²以上での大きな分 極は, 陰極表面において Zr イオンの加水分解 により形成される Zr 酸化物の皮膜抵抗に起 因するものと考えられる。なお,図2,3より, pH2 の Zn-Zr 溶液以外では, Zn 電析は 1000 A・m⁻²付近で, Zn²⁺イオンの拡散限界に到達 しているのに対して, pH2の Zn-Zr 溶液では, 500 A・m⁻² 付近で Zn²⁺イオンの拡散限界に到 達していることが分かる。pH2の Zn-Zr 溶液 で Zn の拡散限界電流密度が低下する要因と しては、Zrイオンの加水分解により形成され る Zr 酸化物の皮膜により, Zn²⁺イオンの拡散 が抑制されることが考えられる。



図 3. Zn²⁺, Zr イオンを含む電解液からの Zn 析出の部分分極曲線

(4) Zr イオン, Zn²⁺を含む溶液からの電析では, 水素発生により陰極近傍の pH が上昇し,加 水分解反応により金属酸化物が生成される。 ZrO2 生成の臨界 pH は、その溶解度積 10^{-25.5}(25°C)より, [ZrO²⁺]=0.05 mol・dm⁻³ では 1.9 となる。同様に、Zn(OH)2 生成の臨界 pH は, その溶解度積 2×10⁻¹⁷(25℃)より, [Zn²⁺]=0.05 mol・dm⁻³では 6.3 である。 図 4 に Zn²⁺, Zr イオンを含む溶液に 5 mol・ dm⁻³の NaOH 溶液を滴定した際の pH 変化を 示す。Zn²⁺のみを含む溶液では pH 6.5 付近で pH の上昇が停滞すると同時に溶液が懸濁し 沈殿が生成し始めた。それに対して、Zrイオ ンのみを含む溶液では初期の pH が 1.2 であ り滴定初期に pH の上昇が停滞し, pH 2.2 付 近で沈殿が生成し始め、その後 pH が上昇し た。ZrイオンとZn²⁺を含む溶液では, pH 1.2 から 2.2 と 5 から 6.5 付近で, pH の上昇が停 滞しており, Zn²⁺のみまたは Zr イオンのみを 含む溶液から得られた pH 滴定曲線を重ね合 わせたものに近い結果となったが、2 段階目 のpH 上昇の停滞(pH 5 から 6.5)が Zn²⁺のみを 含む溶液よりやや低い pH で始まった。これ らの沈殿が形成し始める pH は, それぞれの 金属酸化物の溶解度積より求めた ZrO₂, Zn(OH), 生成の臨界 pH の理論値に近い値と なった。このように,金属酸化物生成の臨界 pH は Zr の方が Zn よりも低いため, 陰極界 面では ZrO2 が優先して形成されると考えら れる。Fig. 5 には、 Zn^{2+} とZrイオンをともに 含む溶液に NaOH 溶液を滴定した際の,溶液 中の Zn²⁺と Zr イオンの濃度も併せて示す。 pH 2.2 付近では, Zr イオンのみの濃度が低下 し, 次に pH の上昇が停滞した pH 5 付近では Zn²⁺の濃度が低下しており, それぞれの pH でZrO₂とZn(OH)₂の沈殿が生じていることを 裏付けている。なお, Zr イオンを含む溶液で は、滴定初期の pH 1.2 から 2.0 の領域では ZrO2の沈殿が形成されていないにもかかわ らず pH の上昇が停滞した。下記(1)の反応は,

pH が-1.03 の時, 平衡となるので, 本研究の pH 1,2 の条件下では Zr イオンは, ZrO²⁺とし て存在すると考えられる。

 $Zr^{4+}+H_2O=ZrO^{2+}+2H^+$ (1) しかし, pH 1.2 から 2.0 の領域では ZrO_2 の沈 殿が形成されていないにもかかわらず pH の 上昇が停滞していることから, 一部の Zr イオ ンは Zr⁴⁺の形で存在し, pH 1.2 から 2.0 で上 記(1)の加水分解反応が生じていることが考 えられる。



図 4. Zn²⁺, Zr イオンを含む溶液に 5 mol・dm⁻³ の NaOH 溶液を滴定した際の pH 変化

(5) Zr イオンと Zn²⁺を含む pH 1.6 の溶液およ び Zn²⁺のみを含む pH 2 の溶液から撹拌無し で電析の際, 微小 Sb 電極法により陰極界面 の pH を直接測定した。図 5 に電流密度 300 A・m⁻²で電析した際の陰極近傍の pH を示す。 陰極表面の pH は, Zn²⁺のみを含む溶液では 溶液本体よりかなり高い 5.6 まで上昇してい るのに対して, Zr イオンを含む溶液では 2.2 程度までしか上昇しなかった。Zn²⁺のみを含 む溶液では, 電解時の水素発生により



図 5. 電流密度 300 A・m⁻²で電析した際の陰 極近傍の pH

Zn(OH)₂生成の臨界 pH まで pH が上昇してい ると考えられる。それに対して、Zr イオンを 含む溶液では Zn(OH)₂生成の臨界 pH より低 い pH でその上昇が停滞した。これは、pH 2.2 付近での Zr イオンの加水分解反応による緩 衝作用が生じるためと考えられる。以上の結 果より、Zr イオン、Zn²⁺を含む溶液からの電 析では、水素発生により陰極表面の pH が上 昇するものの ZrO₂ 形成による緩衝作用のた め, Zn(OH)₂生成の臨界 pH までは pH が上昇 せず, 陰極界面では ZrO₂のみが形成されると 考えられる。 Zn^{2+} は, Zn(OH)₂ を経由しない で ZrO₂層を通過して Zn に還元され, その際 に ZrO₂が Zn と共析すると推察される。

(6) 図 6 に 5000 A・m⁻² で電析させた純 Zn お よび Zn-Zr 酸化物表面の SEM 観察像および EDX スペクトルを示す。純 Zn の電析膜(a) で は六方稠密晶である Zn の板状結晶が大きく 成長して積層しており,その板状結晶のエッ ジ部が明瞭に認められた。また、平滑な板面 上には、多数のステップが見られた。Zr を含 有した電析膜(b)でも、純 Zn の電析膜と同様 に Zn の板状結晶が大きく成長して積層した が,板状結晶のエッジが不規則に変化し歯車 状となった。また、板状結晶の平面上(図中①) および板状結晶と板状結晶の隙間部(図中②) に粒状の結晶が見られた。これら粒状の結晶 ((b)の①, ②)を EDX にて解析したところ(c, d), Znのピーク以外に Zr とOのピークが検出さ れ、ZrはZn板状結晶の板面上および板状結 晶と板状結晶の隙間部に粒状の酸化物とし て共析することが分かった。なお, Zn-Zr 酸 化物で板状結晶のエッジが歯車状となった のは、Zn 板状結晶基底面[{0001}面]の沿面成 長が正常に生じていないことを表している。 Zn 板状結晶の板面に析出した Zr 酸化物が Zn の沿面成長を抑制している可能性もある。



図 6. 5000 A・m⁻²で電析させた純 Zn および Zn-Zr 酸化物表面の SEM 観察像および EDX スペクトル

(7) 3 mass% NaCl 水溶液中における Zn-1.1 mass% Zr 酸化物および純 Zn 電析膜の分極曲線を調べた。図 7 に示すように腐食電位は, Zn-1.1 mass% Zr 酸化物の方が純 Zn に比べ貴であった。Zr 酸化物の共析により Zn 溶解反応のアノード分極曲線が貴に移行しているため,腐食電位も貴に移行したと考えられる。また,アノード反応は Zn-1.1 mass% Zr 酸化物の方が純 Zn に比べ抑制されており,その結果,腐食電流も Zn-1.1 mass% Zr 酸化物の方が小さくなった。これは Zr 酸化物の導電率が極めて小さいためと考えられる。



Potential, E / V vs. NHE

図 7.3 mass% NaCl 水溶液中における Zn-1.1 mass% Zr 酸化物および純 Zn 電析膜の分極曲線

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計4件)

1) Hiroaki Nakano, Yosuke Hara, Satoshi Oue, Shigeo Kobayashi, Electrodeposition of Zn-Zr Oxide Composite from Dispersed-Particle-Free Solution, MATERIALS TRANSACTIONS, vol.57, No.7(2016) pp.1165-1170, 查読有 doi:10.2320/matertrans.M2016084 ② 中野博昭, 原洋輔, 大上悟, 小林繁夫, 分散粒子を含まない溶液からのZn-Zr酸化物 複合電析, 日本金属学会誌 第80巻 第2号 151~156頁 (2016年2月), 査読有 doi:10.2320/jinstmet.J2015038 ③ <u>中野博昭</u>,非懸濁水溶液からの複合電析 防錆管理, Vol.59, No.2, pp54-60, 2015年2月, 査読有 ④ Hiroaki NAKANO, Satoshi OUE, Yasunori ANNOURA, Takaaki NAGAI, Naoto OHO and Hisaaki FUKUSHIMA, Electrodeposition of Zn-V Oxide Composites from a Strongly Agitated Solution without Dispersed Particles ISIJ, vol.54, No.8(2014) pp.1906-1912, 查読有 DOI:http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.54 .1906 〔学会発表〕(計 11件) ① 原 洋輔, 大上悟, 中野博昭, 小林繁夫, 分散粒子を含まない浴からの Zn-ZrO, 複合電 析挙動に及ぼす添加剤の影響 西日本腐食防食研究会・表面技術協会・腐食 防食学会九州支部第 185 回例会合同講演会, 2016年12月2日,九州工業大学(北九州市) ② 分散粒子を含まない溶液からの Zn-Zr 酸 化物複合電析とその構造 原 洋輔, 大上悟, 中野博昭, 小林繁夫 表面技術協会第133回講演大会,2016年3月 22日, 早稲田大学(東京都)

③ 原 洋輔,大上悟,中野博昭,小林繁夫, 分散粒子を含まない浴からの陰極界面の pH 上昇を利用した Zn-ZrO, 複合電析 西日本腐食防食研究会・表面技術協会・腐食 防食協会九州支部第 182 回例会合同講演会, 2015年12月4日,九州工業大学(北九州市) ④ 原 洋輔, 大上悟, 中野博昭, 小林繁夫 陰極界面での水素発生反応を利用した Zn-ZrO2 複合電析挙動とその構造,第62 回材 料と環境討論会秋季講演大会,2015年11月 4日, 福岡工業大学(福岡市) ⑤ 原 洋輔,大上悟,中野博昭,小林繁夫 陰極界面のpH上昇を利用したZn-ZrO2複合電 析挙動とその構造、日本鉄鋼協会秋季講演大 会,2015年9月16日,九州大学(福岡市) ⑥ 原 洋輔, 大上悟, 中野博昭, 小林繁夫 分散粒子を含まない浴からの Zn-ZrO2 複合電 析挙動とその構造, 資源・素材学会秋季講演 大会,2015年9月8日,愛媛大学(松山市) ⑦ 原 洋輔, 大上悟, 中野博昭, 小林繁夫 非懸濁溶液からの Zn-Zr0。複合電析挙動 資源·素材学会九州支部春季例会,2015年6 月12日,九州大学(福岡市) ⑧ 原 洋輔,大上悟,中野博昭,小林繁夫 陰極界面のpH上昇を利用した Zn-ZrO。複合電 析举動,日本金属学会·日本鉄鋼協会九州支 部合同学術講演会, 2015年6月6日, 北九州 国際会議場(北九州市) ⑨ 原洋輔, 大上悟, 中野博昭 分散粒子を含まない浴からの Zr イオンの加 水分解を利用した Zn-ZrO₂ 複合電析挙動 材料プロセス談話会、2015年3月6日、熊本 大学(熊本市) ⑩ 原 洋輔, 大上悟, 中野博昭, 小林繁夫 分散粒子を含まない溶液からの Zn-ZrO₂ 複合 電析,表面技術協会第131回講演大会,2015 年3月4日, 関東学院大学(横浜市) 中野博昭,非懸濁液からの複合めっき 表面技術協会「将来めっき技術検討部会」, 2014 年 7 月 15 日, 産総研, 臨海副都心セン ター(東京都) 〔図書〕(計 0件)

〔産業財産権〕

○出願状況(計 0件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 国内外の別: 〇取得状況(計 0件) 名称: 発明者:

権利者: 種類: 番号: 取得年月日: 国内外の別: [その他] ホームページ等 http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/search/details/K0 01417/index.html 6. 研究組織 (1)研究代表者 中野博昭(NAKANO Hiroaki) 九州大学・大学院工学研究院・教授 研究者番号:70325504 (2)研究分担者 大上 悟(OUE Satoshi) 九州大学・大学院工学研究院・助教 研究者番号:90264085 (3)連携研究者 () 研究者番号: (4)研究協力者

(

)